

日光協 ニュース

No.291/292

2024年11月/12月

日本光学工業協会

本年11月、12月の合併号としてお届け致します。

ISO/TC172/SC1 及び SC1/WG1 及び WG2 ボルダール国際会議

令和6年10月8日(月)～10月10日(水)の期間で、ISO/TC172/SC1、同WG1、WG2、関連するSC3/WG1 合同のボルダール国際会議が開催されました。スケジュールは、下記ご参照ください。

Date	Time*	Room 1	Room 2	Room 3
Monday, 7 th October	9:00 am – 12:00 pm	--	--	--
	1:00 pm – 6:00 pm	--	--	--
Tuesday, 8 th October	9:00 am – 12:00 pm	--	SC 1/WG 1	SC 1/WG 2
	1:00 pm – 6:00 pm	--	SC 1/WG 1	SC 1/WG 2
Wednesday, 9 th October	8:30 am – 12:00 pm	SC 5 - 1 st Plenary SC 5/WG 9	-- SC 5/WG 6	SC 1/WG 1 & 2
	1:00 pm – 6:00 pm	SC 5/WG 9	SC 5/WG 6	SC 1/WG 1 & 2 SC 3/WG 1 & SC 1/WGs
Thursday, 10 th October	9:00 am – 12:00 pm	SC 5/WG 10	SC 5/WG 6	SC 1 – Plenary SC 3/WG 1
	1:00 pm – 6:00 pm	SC 5/WG 10	SC 5/WG 6	SC 3/WG 1
Friday, 11 th October	9:00 am – 12:00 pm	SC 5/WG 3	--	--
	1:00 pm – 3:00 pm	SC 5 - 2 nd Plenary	--	--

日本からは、ISO/TC172/SC1 金山谷委員長、WG1 平井主査、WG2 上田主査、事務局上田が出席いたしました。

下記に、金山谷委員長の報告書の抜粋を添付いたします。

2024年のTC172/SC1の国際会議はUS DenverのBoulderにて、2024/10/8から10/10午前中にかけて2.5日WG1、WG2、WG1+WG2合同に加え、SC1 WG1 + SC3 WG1、および、SC1 Plenary Meetingが開催された。Plenary meetingの内容を中心に報告する。

1. 概要

今回10/08にそれぞれWG1、WG2が同時間に別々で会議開催となった。10/09はWG1+WG2の合同会議、SC1 WG1+ SC3 WG1のジョイントミーティング、10/10はSC1 Plenary Meetingが行われた。ここではPlenary Meetingを中心に報告する。Pメンバーは、SC1議長の米国、を含めて13カ国（ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ナイジェリア、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国）だが、今回のPlenary meetingへの参加は計3カ国に留まった。

会議では、行動規範の確認後Secretary reportとしてISO/TC 172/SC1の現状、この一年の活動内容、ISO指令更新内容等がSC1のcommittee managerのClara Engesserから報告された。

2. SC1 Plenary Meeting 内容

1) 出席メンバー

- i. 日本からの出席者（敬称略）は、上田(日本光学工業協会)、平井(キヤノン)、上田(オリンパスメディカルシステムズ)、金山谷(ニコン)
- ii. 他国含めた出席者は以下

NSB (Country) / Role	Name	Attendance Plenary
Chair	Youngworth, Richie	x
Committee Manager	Engesser, Clara	x
Committee Manager Support	Henigin, Lisa	x
ANSI (United States)		
Head of Delegation	Herman, Eric	x
	Aikens, David	x
	Phenis, Adam	x
	Strobehn, Zachary	x
DIN (Germany)		
Head of Delegation	Jahn, Dirk	x
Convenor ISO/TC 172/SC 1/WG 1	Kiefhaber, Daniel	x
	Hebenstreit, Steffen	x
	Jedamzik, Ralf	x
	Pfeffer, Michael	x
	Schake, Markus	x
JISC (Japan)		
Head of Delegation	Kanayamaya, Nobumichi	x
Liaison Officer ISO/TC 172/SC 3	Murata, Hironobu	x

	Hirai, Shinichirou	x
	Niitsu, Yasuhiko	x
	Ueda, Minoru	x
	Ueta, Soichi	x
Observer / Interpreter	Wada, Kazumi	x
Observer	Tsutomu, Mizugaki	x
Observer	Mao, Ariaki	x

2) 討議および決定内容

i. Report of Secretariat: Committee manager の Clara Engesser から報告。

① 現状の SC1 の構成

1. Committee Manager: Clara Engesser (ドイツ)
2. Chair (until 2024): Richard Youngworth (米国)
 - ① WG1 (General optical test methods) Convener: Daniel Kiefhaber (ドイツ、2026/末まで)
 - ② WG2 (Preparation of drawings for optical elements and systems) Convener: Richard Youngworth (米国、2025/末まで)
 - ③ WG3 (Environmental test methods) Convener: Michel Honlet (ドイツ、2026/末まで)

3. 参加国

- ① Participating countries (12): 前回からナイジェリアが O メンバーに変更
 - ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、ルーマニア、ロシア、スイス、英国、米国
- ② Observing countries (13): 前回から 2 か国増加 (ニュージーランド、ナイジェリア)
 - オーストリア、ブルガリア、チェコ、イラン、ニュージーランド、ナイジェリア、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン

4. リエゾン (SC1 側)

- ① TC10/SC1 (Basic conventions): Clara Engesser (ドイツ)
- ② TC10/SC6 (Mechanical engineering documentation): Clara Engesser (ドイツ) Mr Strobehn
- ③ TC 42 (Photography): Clara Engesser (ドイツ)、Mr Herman
- ④ TC184/SC4 (Industrial data): Clara Engesser (ドイツ)
- ⑤ TC213 (Dimensional and geometrical product specifications and verification): Clara Engesser (ドイツ), Paul E. Murphy (米国)

- ② 新規発行された ISO (2023/9-2024/10)
 - 1. ISO 10109
“Optics and photonics — Guidance for the selection of environmental tests” (WG3; Eric Herman)
- ③ 現行中のプロジェクト
 - 1. ISO/PWI 9358
 - 2. ISO/CD 11421.2
 - 3. ISO/CD 14999-4
 - 4. ISO/CD 10110-5
 - 5. ISO/DIS 9335
 - 6. ISO/DIS 10110-11
 - 7. ISO/DIS 10110-6
- ④ 2025 年の Systematic review
 - 1. ISO 15529:2010 WG1
 - 2. ISO 10110-19:2015 WG2
- ⑤ 2025 年の Systematic review WG3 9 件
 - 1. ISO9022-2:2015 / ISO 9022-6:2015 / ISO 9022-7:2015 / ISO 9022-8:2015 / ISO 9022-11: 2015 / 9022-12: 2015 /9022-14: 2015 /9022-17: 2015 /9022-11: 2015
- ⑥ その他
 - 1. 2025/1 月から新しい Web Tool に移管
詳細は Web 参照 : <https://sway.cloud.microsoft/s4WjFoQKazarZFpF>

ii. 報告すべき議決事項

- ① RESOLUTION 5/2024
(WG1) ISO/PWI 9358 のタイトルを “Optics and Photonics – Veiling glare, Stray light and ghost reflections” から “Optics and Photonics – Stray light” に変更、WD へ移行する。
- ② RESOLUTION 7/2024
(WG1) ISO/DIS 11421 DIS 承認されたので、発行で進める。
ISO/CD.2 11421 “Optics and photonics — Uncertainty of optical transfer function (OTF) measurement”
- ③ RESOLUTION 8/2024
(WG1) ISO/FDIS 9335 DIS 承認されたので発行で進める。

ISO/DIS 9335 “Optics and photonics — Optical transfer function — Principles and procedures of measurement”

④ RESOLUTION 10/2024

(WG1) ISO/SR 19962:2019 Confirm となった。

WG1 から Confirm の Recommendation だったが、WG1 で再度日本からのコメントを確認してもらうことで Confirm 投票した。

⑤ RESOLUTION 11/2024

(SC3/WG1 + SC1/WG1) ISO 15368 “Optics and photonics — Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements”に関する合同協議

ISO/TC 172/SC 3 の ISO/PWI 15368-2 を開始するが、引き続き合同で協議していく。

⑥ RESOLUTION 12/2024, RESOLUTION 13/2024

(WG1+WG2) ISO/CD 14999-4

(WG1+WG2) ISO/CD 10110-5

この 2 件に関しては 9 か月延長し審議を続ける。

⑦ RESOLUTION 14/2024, RESOLUTION 15/2024

(WG1+WG2) ISO/CD 14999-4

(WG1+WG2) ISO/CD 10110-5

各 PL は DIS 案を 2025/1/9 までにドラフトを作成し CM に送る、例外的に DIS 投票前に WG1, WG2 の合同ミーティングを行う。

⑧ RESOLUTION 17/2024

(WG2) ISO 10110-6 の FDIS 承認されたので発行で進める。

ISO/DIS 10110-6 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 6: Centring and tilt tolerances”

⑨ RESOLUTION 18/2024

ISO 10110 シリーズの GPS の使用について図面記載でメカ図面ルールを光学図への適用について今後協議していく。CM

⑩ RESOLUTION 19/2024

(WG2) ISO 10110-11.2 の DIS 承認されたので発行で進める。

ISO/DIS 10110-11 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 11: Non-toleranced data”

Project Leader: Jennifer Michels (米国)

- ⑪ RESOLUTION 20/2024
ISO/SR 10110-1 Confirm and call for PL
Confirm となったが PL が不在 2025/4/15 までに決める必要がある。
- ⑫ RESOLUTION 24/2024
(SC3/WG1 + SC1/WG1) ISO 10110-18 については PWI で進める。
SC3 の ISO12123 の動向と合わせて進めていく。
ISO 10110-18 “Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 18: Stress birefringence bubbles and inclusions, homogeneity, and striae”
- ⑬ RESOLUTION 23/2024
ISO/DIS 10110-9 については PWI で進めていく。
Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 9: Surface treatment and coating
- ⑭ RESOLUTION 26/2024
(SC) 2025 年の SR について、以下の 2 回に分けて SR を実施する。
2025-01-15:
In the scope of WG 1
→ ISO 15529:2010 Optics and photonics — Optical transfer function — Principles of measurement of modulation transfer function (MTF) of sampled imaging systems
In the scope of WG 2
→ ISO 10110-19:2015 Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Part 19: General description of surfaces and components
In the scope of WG 3:
→ ISO 9022-2:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 2: Cold, heat and humidity
→ ISO 9022-11:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 11: Mould growth
→ ISO 9022-12:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 12: Contamination
→ ISO 9022-14:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 14: Dew, hoarfrost, ice

2025-04-15:

In the scope of WG 3:

→ ISO 9022-6:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 6: Dust

→ ISO 9022-7:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 7: Resistance to drip or rain

→ ISO 9022-8:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 8: High internal pressure, low internal pressure, immersion

→ ISO 9022-17:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 17: Combined contamination, solar radiation

→ ISO 9022-20:2015 Optics and photonics — Environmental test methods — Part 20: Humid atmosphere containing sulfur dioxide or hydrogen sulfide

⑮ RESOLUTION 23/2023

次回国際会議について、2025年はVirtual、2026年はSC3がF2Fなら日本で開催、SC3がvirtualなら2026年もSC1はVirtual。この場合2027年にF2Fを日本で開催。

3) Plenary 報告

i. 決議同日インドが欠席、CM からきちんと連絡が行っていなかった反省から始まり、例年通り、SC1 の活動報告から行われた。特記事項としては 2025 年 1 月から Web ツールが変更になりより使いやすいものになるとのこと。

ii. 各決議に関して

① 基本各 WG で決めた Recommendation について報告のため、承認形式で進められた。US や日本は WG で反対意見を表明していた一部案件も CM の配慮により各国の想いを Resolution のコメントに反映されたが決議は Recommendation を尊重し決議となった。

② 次回国際会議について、SC1 JISC からは 2 年間の準備が必要とのコメントを出していた。そのためオブザーバー参加の SC3 に 2026 年にするか 2027 年にするかを迫ったが、回答出ず SC3 の持ち帰り。その後 12 月に SC3(国内)分科会にて 2026 年日本開催の合意を得られた回答あり。

4) その他

- i. 国際会議開始前に Chair から「コミュニケーションが難しいだろうから日本には確認で合図を送る」旨を打診され、了承し会議が始まった。また事前に話したいことを相談しておくとの会議では配慮もしてくれる状況だった。今回 ISO14999-4 と 10110-5 に関しては事前準備で報告資料を作成し各国に送って協議ができていればもう少し良い方向に話せたかと思う。可能であれば CD の投票の時にテクニカルコメントの場合、説明資料を用意できると各国の理解が深まると感じた。

以上

令和 6 年度後期技能検定の準備作業終了

令和 6 年 11 月 8 日(金)に、港区芝公園の機械振興会館会議室において、令和 6 年度後期技能検定「光学機器組み立て作業」の実技試験で使用する器材の点検が行われました。この日は、関連各社（オリンパスメディカルシステムズ(株)、キヤノン(株)、(株)トプコン、(株)ニコン、ギガフォトン(株)より推薦された 7 名の技能検定委員の方々により、ガラス部品・備品・副資材等を中心に入念な点検が行われました。

令和 6 年度後期技能検定 首席・事務局会議開催及び実技試験実施について

令和 6 年 11 月 28 日(木)午前、千代田区飯田橋 工業教育会館会議室にて、令和 6 年度後期技能検定 首席技能検定委員・事務局会議が開催されました。当協会からは、安藤首席技能検定委員及び事務局長が出席いたしました。

会議では、冒頭委嘱状の交付が東京都職業能力開発協会より行われ、その後技能検定試験に関する様々な注意事項の説明が行われました。

同日の午後、港区芝公園の機械振興会館会議室において、水準調整会議が開催されました。技能検定関連各社（オリンパス(株)、キヤノン(株)、(株)トプコン、(株)ニコン、ギガフォトン(株)の事務局及び技能検定委員が参加しました。

また、今年度の東京都における「光学機器組立て作業の実技試験」は、12 月 7 日(土)、8 日(日)、14 日(土)の 3 日間に実施されました。1 級 13 人、2 級 18 人、合計 31 人の方が受験しました。

年末年始における年次有給休暇取得促進の御協力について(御依頼)

雇均総発 1021 第 1 号 令和 6 年 10 月 21 日

厚生労働省雇用環境・均等局総務課長より、標記の件に関する連絡がございました。以下に抜粋を記します。

厚生労働行政の運営につきましては、平素より格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、年次有給休暇の取得率につきましては、令和 4 年に 62.1%と、前年より 3.8 ポイント上昇し、過去最高を更新したものの、依然として政府目標である 70%とは乖離があります。このため、厚生労働省では、10 月の「年次有給休暇取得促進期間」に続き、この年末年始における年次有給休暇の取得促進の機運を醸成するための取組を行うこととしました。

具体的には、計画的な業務運営や休暇の分散化に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1) や、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※2) の活用を含め、年次有給休暇を積極的に取得いただくことにより働き方・休み方の見直しを促すポスター及びリーフレットを作成し、これらを用いた広報や労使への働きかけ等を行うこととしております。

つきましては、貴職におかれても、本取組の趣旨を御理解いただき、同封のポスターの掲示やリーフレットの配布、広報誌への掲載等により、傘下企業等への周知に御協力いただきますようお願いいたします。

なお、リーフレットについては、以下サイトにも掲載しておりますので併せてご活用ください。

○年次有給休暇取得促進特設サイト

<https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/>

長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書

厚生労働大臣 福岡資磨 令和 6 年 10 月 24 日

厚生労働大臣より、標記の件に関する連絡がございました。以下に抜粋を記します。

日頃より、労働行政の推進に格別の御配意を賜り、厚く御礼申し上げます。

過労死等防止対策推進法(平成 26 年法律第 100 号)では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされており、同法に基づく「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和 6 年 8 月 2 日閣議決

定)では、過労死等防止対策の数値目標として、週労働時間 40 時間以上の雇用者のうち週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を 5%以下とする(和 10 年まで)、年次有給休暇の取得率を 70%以上とする(令和 10 年まで)等が掲げられています。

近年、過労死等の労災支給決定件数は増加傾向にあり、また、本年 4 月からは、建設事業、自動車運転の業務、医師等についても、時間外労働の上限規制が適用されています。

このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11 月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。

貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めて過重労働解消キャンペーンの趣旨を御理解いただき、次の事項が着実に取り組まれるよう、傘下団体・企業等に対する周知啓発について御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

令和 6 年度化学物質管理強調月間の実施に伴う協力依頼について

厚生労働省発基安 1129 第 5 号 令和 6 年 11 月 29 日

厚生労働省事務次官より、標記の件に関する連絡がございました。以下に抜粋を記します。

化学物質による労働災害の防止につきましては、平素から格別の御協力を賜わり深く感謝申し上げます。

厚生労働省におきましては、産業界における自律的な化学物質管理活動を推進するとともに、広く一般に職場における危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識の高揚を図るため、このたび化学物質管理強調月間を創設し、主唱しております。

別添の「令和 6 年度化学物質管理強調月間実施要綱」に基づき、令和 7 年 2 月 1 日から 2 月 28 日までを化学物質管理強調月間として、

「正しく理解 正しく管理 化学物質と向き合おう」

をスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。

つきましては、この強調月間の趣旨を御理解いただき、関係機関及び傘下の団体等に対する周知等格段の御協力を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。

2024年9月生産・出荷累計統計

	生産		受入 数量	出荷			月末在庫 数量
	数量	金額 (百万円)		販売		その他 数量	
				数量	金額 (百万円)		
デジタルカメラ	245,250 (1.36)	14,118 (1.47)	416,026 (1.46)	253,689 (1.28)	20,794 (1.28)	415,521 (1.48)	251,658 (1.25)
フィルムカメラ	7,205 (1.23)	9,043 (1.17)	6,445 (0.96)	7,250 (1.01)	10,136 (1.05)	6,175 (1.22)	13,847 (0.82)
交換レンズ	158,299 (1.46)	9,862 (1.27)	544,549 (1.64)	409,687 (1.35)	22,996 (1.18)	329,686 (1.81)	1,024,160 (0.95)
光学・精密測定機	17,583 (0.83)	5,842 (1.07)	—	31,025 (1.33)	7,866 (1.6)	—	90,471 (0.79)
光分析機器	14,316 (1.05)	29,078 (1.25)	—	13,854 (1)	30,908 (1.39)	—	23,806 (1.69)
測 量 機	2,255 (0.74)	621 (0.91)	—	10,944 (1.52)	1,807 (1.4)	—	7,465 (0.48)
合 計	—	68,564 (1.26)	—	—	94,507 (1.28)	—	—

() 内は、前年比

注) 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

- (イ) 他企業から購入したもの(輸入を含む)
- (ロ) 同一企業内の他工場から受入れたもの
- (ハ) 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの
- (ニ) 返品(戻入れ)されたもの

令和6年12月27日発行

日本光学工業協会

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 204 号室

電話・ファックス: 03-3431-7073

<https://www.e-joia.jp> e-mail: joia.office@e-joia.jp

発行人 牛田 一雄

編集 上田 壮一 (事務局)